

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2001 年 1 月 11 日 (11.01.2001)

PCT

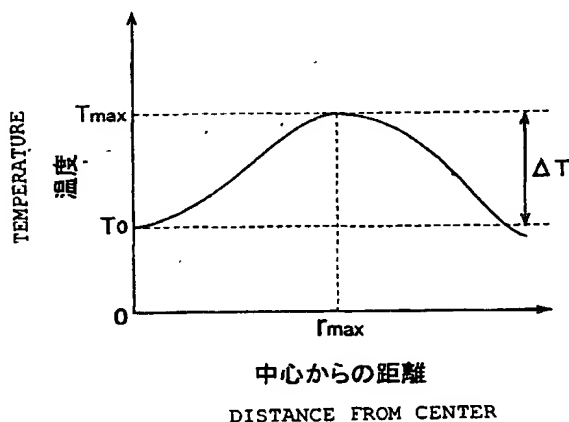
(10) 国際公開番号
WO 01/02311 A1

- (51) 国際特許分類⁷: C03B 20/00, 8/04 (72) 発明者; および
(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 中川和博 (NAK-
AGAWA, Kazuhiro) [JP/JP]. 平岩弘之 (HIRAIWA, Hi-
royuki) [JP/JP]; 〒100-8331 東京都千代田区丸の内三
丁目2番3号 株式会社 ニコン内 Tokyo (JP).
- (21) 国際出願番号: PCT/JP00/04466 (74) 代理人: 弁理士 長谷川芳樹, 外 (HASEGAWA,
Yoshiki et al.); 〒104-0061 東京都中央区銀座二丁目6
番12号 大倉本館 創英国際特許法律事務所 Tokyo (JP).
- (22) 国際出願日: 2000 年 7 月 5 日 (05.07.2000)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願平11/190117 1999 年 7 月 5 日 (05.07.1999) JP (81) 指定国 (国内): AE, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG,
BR, BY, CA, CH, CN, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, EE, ES,
FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE,
KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD,
MG, MK, MN, MW, MX, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD,
SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ,
VN, YU, ZA, ZW.
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 株式会社
ニコン (NIKON CORPORATION) [JP/JP]; 〒100-8331
東京都千代田区丸の内三丁目2番3号 Tokyo (JP). (84) 指定国 (広域): ARIPO 特許 (GH, GM, KE, LS, MW,
MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), ユーラシア特許 (AM,

[続葉有]

(54) Title: METHOD FOR PRODUCING QUARTZ GLASS MEMBER AND QUARTZ GLASS MEMBER PRODUCED THEREBY

(54) 発明の名称: 石英ガラス部材の製造方法およびその方法により得られる石英ガラス部材



(57) Abstract: A method for producing a quartz glass member which comprises a step of reacting a silicon compound in oxy-hydrogen flame by using a burner having a concentric multiple structure, to thereby prepare fine quartz glass particles, a step of depositing the fine quartz glass particles on a supporter, which is arranged to be opposed to the burner and is rotating, with a temperature distribution which is symmetric with respect to the rotating axis of a quartz glass ingot in at least one plane perpendicular to the rotating axis and has a maximum value between the center and the periphery of the plane, to thereby provide a quartz glass ingot, and a step of cutting, from the above quartz glass ingot, a quartz glass member which has signed double refraction values increasing monotonously from the center toward the periphery of a face perpendicular to the rotating axis of the above quartz glass ingot, the signed double refraction values being determined based on double refraction values and the direction of the advanced phase axis thereof measured at plural positions of the plane.

[続葉有]

WO 01/02311 A1